

เอกสารอ้างอิง

1. R. W. Thormae, Nucl. Instr. And Meth. In Phys. Res. B139(1998) 37-42.
2. A. Anders, Surface and Coatings Technology 1(2002) 1-10.
3. I. G. Brown, J. E. Galvin, and R. A. MacGill, Appl. Phys. Lett. 47(1985) 358-360.
4. I. G. Brown, IEEE Transactions on plasma science PS-15(1987) 346-350.
5. I. G. Brown, Rev. Sci. instrum. 63(1992) 2351-2355.
6. I. G. Brown, Rev. Sci. instrum. 65(1994) 3061-3081.
7. J. Storer, J.E. Galvin and Ian G Brows, J. Appl. Phys.66(1989) 5245-5249.
8. I. G. Brown, A. Anders, M.R. Dickinson, R.A. MacGill and O.R. Morimoto, Surface and Coatings Technology 112(1999) 271-277.
9. T. Zhang, B. Y. Tang, Z. M. Zeng, T. K. Kwok, and P. K. Chu, Rev. Sci. instrum. 70(1992) 4359-4361.
10. S. S. Kim, J. G. Han, and S. Y. Lee, Thin Solid Films 334(1998) 133-139.
11. Z. M. Zeng, T. Zhang, B. Y. Tang, X. B. Tian and P. K. Chu, Surface and Coatings Technology 115(1999) 234-238.
12. H. Takikawa, K. Kimura, R. Miyano, T. Sakakibara, A. Bendavid, P. J. Martin, Akihito Matsumuro and K. Tsutsumi, Thin Solid Films 386(2001) 276-280.
13. Y.S Choong, B. K. Tay, S. P. Lau, X. Shi and Y. H. Cheng, Thin Solid Films 386(2001) 1-5.
14. S. Davydov, B. Yotsombat, L. D. Yu, P. Pramukul, R. Charoennukul and T. Vilaithong, Surface and Coatings Technology 131(2000) 39-43.
15. E. M. Oks, I. G. Brown, M. R. Dickinson, R. A. MacGill, H. Emig, P. Spadtke and B. H. Wolf, Appl. Phys. Lett. 67(1995) 200-2002.
16. F. J. Paoloni and I. G. Brown, Rev. Sci. instrum. 66(1995) 3855-3858.
17. L. Xianghui, Surface and Coatings Technology 131(2000) 261-266.
18. I. G. Brown, Surface and Coatings Technology 136(2001) 16-22.
19. N. W. Cheung, Trans. Mat. Res Soc. Jpn. 17(1994) 543-548.

20. T. Zhang, B. Y. Tang, Z. M. Zeng, Q. C. Chen, X. B. Tian, T.K. Kwok, P. K. Chu, O. R. Monteiro and I. G. Brown, *Surface and Coatings Technology* 128-129(2000) 231-235.
21. G. M. Pharr, D. L. Callahan, S. D. McAdams, T.Y. Tsui, S. Anders, A. Anders, J.w. Ager III, I.G. Brown, C. S. Bhatia, S. R. P. Silva and J. Robertson, *Appl. Phys. Lett* 68(1996) 779-781
22. R. W. Thomae, *Nucl. Instr. And Meth. In Phys. Res. B*139(1998) 37-42.
23. M. Ueda, G. F. Gomes, L. A. Berni, J. O. Rossi, J. J. Barroso, A. F. Beloto, E. Abramof, and H. Reuther, *Nucl. Instr. And Meth. In Phys. Res. B*161-163(2000) 1064-1068.
24. S. Anders, A. Anders and I. G. Brown, *Rev. Sci. instrum.* 65(1994) 1253-1257.
25. S. Anders, A. Anders, K. M. Yu, X. Y. Yoa and I. G. Brown, *IEEE Transaction on plasma science* 21(1993) 440-445.
26. S. Anders, A. Anders, I. G. Brown, R. M. MacGill and M. R. Dickinson, *Rev. Sci. instrum.* 65(1994) 1319 – 1321.
27. A. Anders, S. Anders, and I. G. Brown, *Plasma Source Sci. Technol.* 4(1995)1-12.
28. G. Y. Yushkov, A. Anders, E. M. Oks and I. G. Brown, *J. Appl. Phys.* 88(2000)1-5.
29. X. Tian and P. K. Chu, *Physics Letters A* 277(2000) 42 – 46.
30. B. Chapman, "Glow Discharge Processes", John Wiley & Son, Inc., USA. (1980) 49 – 56.